EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02153583

PUBLICATION DATE

13-06-90

APPLICATION DATE

06-12-88

APPLICATION NUMBER

63306849

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR : KITA HIDEKI;

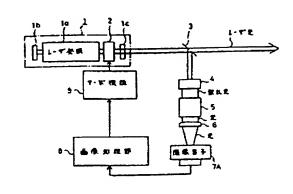
INT.CL.

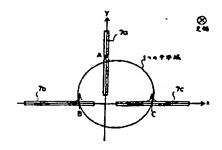
H01S 3/137

TITLE

CONTROLLER FOR STABILIZING

WAVELENGTH





ABSTRACT :

PURPOSE: To accurately know the center and the diameter of an interference fringe so as to control wavelength to keep it stable for a long period even if an optical axis deviates by a method wherein three linear image sensors two-dimensionally arranged are used.

CONSTITUTION: An optical means is provided with a beam splitter 3, a scattering plate 4, a Fabry-Perot etalon 5, and a convex lens 6. Linear image sensors 7a, 7b, and 7c of an image sensing element 7A are arranged on a plane which is vertical to an optical axis and separate from the lens 6, the long side of the sensor 7a lines along a y axis, and the long sides of the sensors 7b and 7c line in -x and +axis directions respectively. Concerning the position of the light intensity peak and the diameter of an interference fringe formed on the sensors 7a, 7b, and 7c, even if the center of the interference fringe circle is not located on the x axis, the diameter of the circle can be accurately obtained. A servo mechanism 9 controls a Fabry-Perot etalon 2 comparing the diameter of an interference fringe circle with an initially set value.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開

平2-153583 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月13日

H 01 S 3/137

7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 波長安定化制御装置

> **②特** 頤 昭63-306849

願 昭63(1988)12月6日 @出

個発

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 伊丹製作所内

三菱電機株式会社 ⑪出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 曾我 道照 外4名

1. 発明の名称

波長安定化制物裝置

2. 特許請求の範囲

レーザ光の一部を散乱し分光して集光する光 学手段、上記集光された光の干渉絡を2次元的に 摄像する摄像素子、上記2次元的に摄像された干 渉縞の像を演算処理してその干渉縞の位置を求め る面偽処理部、及び上記求めた干渉縞の位置に基 づいて上記レーザ光の波長を選択する波長選択素 子を制御するサーボ機構を備えたことを特徴とす る波長安定化制御装置.

3. 発明の詳細な説明

[産菜上の利用分野]

この発明は、半導体製造プロセスにおけるリソ グラフィー(LSIのパターン露光)などの光源と して使用される、狭帯化(波長選択)されたエキシ マレーザのレーザ発振装置の波長安定化制御装置 に関するものである。

特に、2次元に配置された複数のリニアイメー

ジセンサによって、光の干渉縞(フリンジ)の直径 を正確に求めることができるので、光軸のズレを 容易に補正することができる等の長所を有するレ ーザ発掘装置の波長安定化制御装置に関するもの

[従来の技術]

従来例の構成を第4図及び第5図を参照しなが ら説明する。第4図は、例えば『 IEEE Journal Quantum Electrics, QE-14(1978) 17頁に示された従来の波長安定化制御装置を示す ブロック図であり、第5図は、従来の波長安定化 制御装置の摄像素子(7)を示す平面図である。

第4図において、従来の波長安定化制御装置は、 レーザ 発 援 装 置 (1)から出力されたレーザ 光の 光 ・軸上に設けられたピームスプリッター(3)と、こ のピームスプリッター(3)の直角方向の光軸上に 設けられた散乱板(4)と、この散乱板(4)の出口 例に設けられたファブリペローエタロン(5)と、 このファブリペローエタロン(5)の出口側に設け られた凸レンズ(6)と、この凸レンズ(6)の透過

個に設けられた摄像素子(7)と、この摄像素子(7)に接続された画像処理部(8)と、この画像処理部(8)に入力側が接続されかつファブリペローエタロン(2)に出力側が接続されたサーボ機構(9)とから構成されている。

なお、レーザ発振装置(1)は、レーザ発振器(1a)と、このレーザ発振器(1a)の両側に配置された全反射ミラー(1b)及び部分反射ミラー(出力ミラー)(1c)と、レーザ発振器(1a)と部分反射ミラー(1c)の間に配置された波長選択素子例えばファブリベローエタロン(2)とから構成されている。

第5図において、提像素子(7)は、1次元のイメージセンサであるリニアイメージセンサ(7.)から構成されている。このリニアイメージセンサ(7.)は長辺方向が×軸方向に沿うように配置されている。

つぎに、上述した従来例の動作を第5図及び第6図を参照しながら説明する。第6図は、従来の 波長安定化制御装置により得られた干渉精の強度 分布を示す波形図である。

第6図の実践で示すように、干渉綿の強度分布が、画像処理部(8)の演算処理によって得られる。 干渉絡の1つの直径 Daは、

D m = 2 f θ m ... ②
{ただし、f:凸レンズ(6)と環像素子(7)との間の距離、θ m = arccos(m λ m/2 n d)}から求めることができる。

したがって、第5 図及び第6 図の点線で示すように、干渉縞の光粒すなわち中心波長 A mがズレると、第5 図で示すように、求める直径が D mから D m* (D m* < D m)に変化し、正確な直径 D mが求められなくなる。

この直径 D m を 表わす 信号が、サーボ機構(9)にフィードバックされ、 光共振器の長さすなわちファブリペローエタロン(2)のギャップがサーボ機構(9)によって 制御調節される。 すなわち、 ②式より、レーザ光の波長 入 m が長いと、 干渉縞の直径 D m が小さくなり、 波長 入 m が短いと、 直径 D m が大きくなる

従来の波長安定化制御装置は、上述したように

レーザ発掘装置(1)から出力されたレーザ光の 被長は、光共振器の長さを変えることによって、 すなわち、被長選択素子であるファブリベローエ タロン(2)のギャップを変えることによって選択 することができる。

まず、レーザ発振装置(1)から出力されたレーザ光の一部が、ビームスプリッター(3)によって取り出され、散乱板(4)によって散乱されて、ファブリペローエタロン(5)によって分光される。

このファブリペローエタロン(5)を透過することができる光の中心波長入mの条件は、

上記条件式①を満たす波長の光だけが、光軸に 垂直な面上に、同心状の干渉縞を発生することに なる。この干渉縞は、凸レンズ(6)によって集光 されて、提倡業子(7)上に導かれる。

1 次元のリニアイメージセンサを使用し、位和検 波を利用した制御を行っている。

[発明が解決しようとする課題]

上述したような従来の波長安定化制御装置では、 振像素子として1次元のイメージセンサを使用し ているので、操像素子を干渉縞の光軸上に正確に 配置するように到節しなければならないという問 頭点があった。

また、熱や振動などにより巤像素子と干渉輪の 光軸がズレても、補正をすることができないとい う同題点があった。

この発明は、上述した問題点を解決するためになされたもので、提像架子を干渉額の光軸上に配置するように調節することが容易になり、透像架子と干渉額の光軸のズレを補正することができる
波長安定化制御装置を得ることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る波長安定化制御装置は、以下に 述べるような手段を備えたものである。

(i). レーザ光の一部を 散乱し分光して集光す

る光学手段.

(ii). 上記集光された光の干渉縞を 2 次元的に 提像する摄像素子。

(iii). 上記2次元的に機像された干渉絡の像を 演算処理してその干渉絡の位置を求める面像処理 部。

(iv). 上記求めた干渉絡の位置に基づいて上記レーザ光の波長を選択する波長選択案子を制御するサーボ機構。

[作用]

この発明においては、提像素子によって、集光 された光の干渉縞が2次元的に最像される。

つづいて、画像処理部によって、上記 2 次元的 に儘優された干渉結の像が演算処理されて、その 干渉結の位置が求められる。

そして、サーボ機構によって、上記求めた干渉 続の位置に基づいて、レーザ光の波長を選択する 波長選択素子が制御される。

〔 実施例〕

2つの実施例、すなわち第1実施例及び第2英

配置され、リニアイメージセンサ (7b)及び (7c)は 同様に長辺方向がそれぞれ-x軸及び+x軸方向に 沿うように配置されている。

つぎに、上述した第1実施例の動作を第2図を 参照しながら説明する。

第2図で示すように、1つの干渉額が3つのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7c)上につくる光の強度のピーク位置をA(0.51)、B(x2.0)、C(x3.0)とすると、この干渉額の中心(a.b)は、

 $(a,b) = ((x_2 + x_3)/2, (y_1^2 + x_2x_3)/2y_1)$ と表され、また直径 D は、

 $D = \sqrt{((x_2! + y_1^2)(x_2^2 + y_1^2))}/y_1$ と表される。

したがって、干渉騒の円の中心がx軸上にない場合でも、その直径を正確に知ることができる。サーボ機構(9)は、上述した直径Dと、初期に設定した値とを比較してファブリペローエタロン(2)を制御する。

上述したこの発明の第1実施例は、2次元的に 配置された3つのリニアイメージセンサ(7a)、 施例について説明する。

最初に、第1 実施例の構成を第1 図及び第2 図を参照しながら説明する。第1 図は、この発明の第1 実施例を示すブロック 図であり、提像素子(7A)以外は上記従来装置のものと全く同一である。また、第2 図は、この発明の第1 実施例の提像素子(7A)を示す平面図である。

第1図において、この発明の第1実施例は、上述した従来装置のものと全く同一のものと、凸レンズ(6)の透過側に設けられた接像業子(7A)とから構成されている。

ここで、この発明の光学手段は、ビームスプリッター(3)と、散乱板(4)と、ファブリペローエタロン(5)と、凸レンズ(6)とから構成されている。第2図において、振優素子(7A)は、3つのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7c)から構成されている。これらのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7c)は、凸レンズ(6)から距離(f)だけ離れ光軸に垂直な面内に配置され、リニアイメージセンサ(7a)は長辺方向が m軸方向に沿うように

(7b)及び(7c)を使用したので、光軸がズレても、 干渉橋の中心及び直径を求めることができるので、 波長を長時間安定に制御することができる。

また、光軸ズレや面おれを補正できるので、最像業子であるリニアイメージセンサ(7▲)、(7b)及び(7c)の取り付け精度の許容範囲が大きくなり、工作が容易になる他、部品加工が安価で済む。

第2番目に、この発明の第2実施例の構成及び 動作を第3図を参照しながら説明する。第3図は、 この発明の第2実施例の接後素子(78)を示す平面 図である。

この発明の第2実施例は、上述した第1実施例のうち摄像素子(7A)の代わりに、摄像素子(7D)から構成されている。

第3図において、摄像業子(7B)は、6つのリニアイメージセンサ(7d)、(7e)、(7f)、(7g)、(7h)及び(7i)から構成されている。これらのリニアイメージセンサ(7d)、(7e)、(7f)、(7g)、(7h)及び(7i)は、凸レンズ(6)から距離(f)だけ離れた面内に配置され、リニアイメージセンサ(7d)は長辺

特間平2-153583(4)

方向が + x軸方向に沿うように配置され、他のリニアイメージセンサ (7e)、 (7f)、 (7g)、 (7h)及び (7i)は、リニアイメージセンサ (7d)を基点にして同一面内に60度毎に配置されている。

したがって、干渉舗の位置に関するデータが6 点得られるならば、センサ面が光輪に対して垂直 でない場合でも光軸ズレや面ぶれを補正できる。

なお、上記第1及び第2実施例では、干渉橋の位置が所定の半径(r)以内にあることを条件にして、光軸位置に関する警報を出すこともできる。

また、上記実施例では1次元のリニアイメージセンサを複数配置して2次元の最優素子を構成したが、例えばCCD等の2次元の最優素子を使用しても所期の目的を達成し得ることはいうまでもない。

[発明の効果]

この発明は、以上説明したとおり、レーザ光の一部を散乱し分光して集光する光学手段と、上記集光された光の干渉緒を2次元的に摄像する遺像素子と、上記2次元的に摄像された干渉器の像を

- (3) … ビームスプリッター、
- (4) … 散乱板、
- (5) … ファブリベローエタロン、
- (6) … 凸レンズ、
- (7A) … 接做菜子、
- (8) … 画像処理部、
- (9) … サーボ機構である。

なお、各図中、同一符号は同一、又は相当部分 を示す。

代理人 曾我 道照



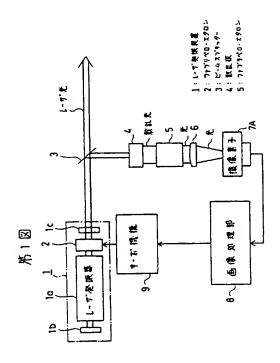
福力処理してその干渉納の位置を求める画像処理部と、上記求めた干渉納の位置に基づいて上記レーザ光の波長を選択する波長選択素子を制御するサーボ機構とを備えたので、緩像素子を干渉納の光軸上に配置するように調節することが容易になり、協像素子と干渉鍋の光軸のズレを補正することができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

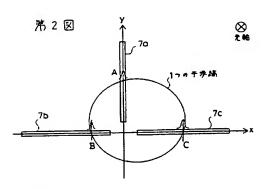
第1 図はこの発明の第1 実施例を示すブロック図、第2 図はこの発明の第1 実施例の提係素子を示す平面図、第3 図はこの発明の第2 実施例の提係素子を示す平面図、第4 図は従来の被長安定化制御装置を示すブロック図、第5 図は従来の被長安定化制御装置により得られた干渉結の強度分布を示す波形図である。

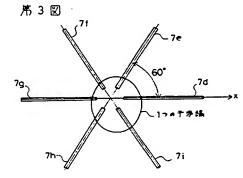
図において、

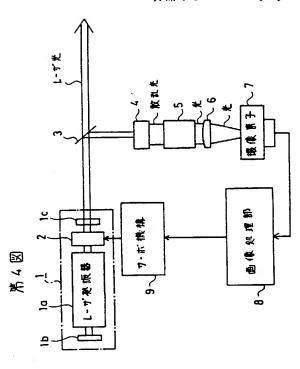
- (1) … レーザ発振装置、
- (2) … ファブリペローエタロン (波長選択素子)、

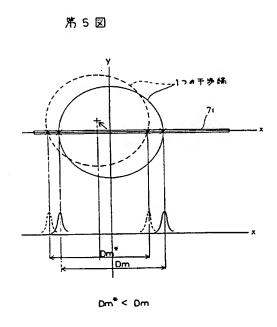


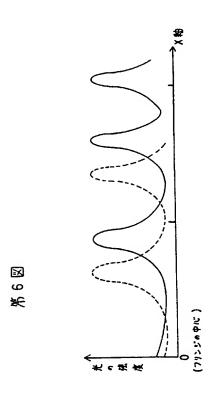
特開平2-153583 (5)











THIS PAGE BLANK (USPTO)